# 高効率な電圧磁気異方性制御 電圧駆動型スピントロニクスデバイスの基盤技術を開発



**野崎 隆行** のざき たかゆき nozaki-t@aist.go.jp

ナノスピントロニクス研究 センター 金属スピントロニクスチーム 主任研究員 (つくばセンター)

## 関連情報:

○ 共同研究者

薬師寺 啓、田丸 慎吾、関根 正樹、松本 利映、甲野藤 真、 久保田 均、福島 章雄、湯浅 新治(産総研)

# 参考文献

T. Nozaki *et al.: Appl. Phys. Exp.*, 6, 073005 (2013).

#### ) プレス発表

2013年6月24日「電圧 による磁化制御を高効率化」

この研究開発は、独立行 政法人 科学技術振興機構の 委託事業「革新的プロセス による金属 / 機能性酸化物 複合デバイスの開発(平成 21~27年度)」(研究総括: 渡辺 久恒、研究代表者:湯 浅 新治)による支援を受け て行いました。

# スピントロニクスデバイスの課題

電子がもつ磁気的な性質である"スピン"を利 用する「スピントロニクスデバイス」は、電力を 供給し続けなくてもスピン(磁化)の向きが元に 戻らない"不揮発性"と呼ばれる特長を持つた め、待機電力がほとんど要らない磁気メモリー などの開発が進められています。しかし、情報 の操作(磁化の方向や運動の制御)には、現在の ところ大きな電流を用いる必要があり、ジュー ル熱による不要なエネルギー消費が駆動電力低 減の大きな壁となっています。そのため、電流 ではなく電圧によって磁化状態を制御する技術 が望まれています。

# 二重絶縁層構造で電圧磁気異方性制御を高効率化

私たちはこれまで、数原子層まで超薄膜化し た金属磁石の磁気異方性を電圧で制御する技術 の開発に取り組んできました。これまでは電圧 磁気異方性制御の実証には単層バリア型の強磁 性トンネル接合素子が用いられてきました。一 方、産総研では、電流駆動型デバイスの開発過 程において、鉄とホウ素の合金からなる金属磁 石層 (FeB層)を酸化マグネシウム (MgO) 絶縁 層二層で挟んだ構造では、FeB層の磁化が膜面 に垂直な方向に強く向き(垂直磁気異方性)、こ の構造が大容量化に有効であることを見いだし ました。今回は、この構造を用いて電圧効果の 効率増大に取り組みました。

二重絶縁層構造を電圧駆動化するために、こ れまでは2ナノメートル以上の膜厚であった金 属磁石層を1.5ナノメートルまで超薄膜化し、 MgOの絶縁層で挟んだ構造としました(図1)。 この素子に電圧を加えた状況下でトンネル磁気 抵抗効果を測定し、垂直磁気異方性変化の定量 評価を行いました。

図2にFeB層の垂直磁気異方性の印加電圧依 存性を示します。正の電圧方向において、垂直 磁気異方性の変化は従来構造(黒線)よりも大き く増大し、約3倍の傾きで変化しました。この 傾きは電圧による制御性の効率を直接示すも ので、二重絶縁層構造がこれまでの3倍にもな る高効率な電圧制御ができることを示していま す。垂直磁気異方性の大きな構造で大きな電圧 効果の実現により、Gbitスケールを目指した微 小磁性素子でも電圧制御が適用できることが示 されました。

#### 今後の予定

今後は金属磁石材料や素子構造の最適化を進 め、磁気異方性変化効率の増大を目指すととも に、電圧駆動型3端子スピン増幅素子などの、 新しい機能性をもつスピントロニクス素子、さ らにはグリーンITの実現を目指します。







図2 電圧印加による磁気異方性変化の実験結果